

公益社団法人 応用物理学会

薄膜・表面物理分科会／シリコンテクノロジー分科会 共催

第31回 電子デバイス界面テクノロジー研究会 ー材料・プロセス・デバイス特性の物理ー

■ 2026年1月29日(木)～1月30日(金)

■ 東レ総合研修センター(静岡県三島市)

■ ウェブサイト <http://edit-ws.jp/>



➤ チュートリアル講演

高木 信一 (帝京大学)

➤ 基調講演

齋藤真澄(キオクシア)

小椋 厚志 (明治大学)

➤ 招待講演

押山 淳 (東北大学), 川那子 高暢 (産総研),

黒澤 昌志 (名古屋大学), 齊藤 雄太 (東北大学),

山本 圭介 (熊本大学)

➤ 企画セッション

“EUV リソグラフィ技術の歴史と将来 (仮題)”

一般講演募集 (口頭またはポスター発表)

2025年11月14日(金)締切

本研究会は参加者による“議論”を目的としていますので、予稿集は出版物ではなく参加者限りの資料となります。予稿集の引用や2次利用は想定していません。

